

東北大学マイクロシステム融合研究開発センター 試作コインランドリ 主要装置リスト (2023年4月～)

■施設使用料 (1人あたり) 学外: 530円/時間、学内: 360円/時間 (改定前 学外: 480円/時間、学内: 310円/時間)

■技術支援料 6,514円/時間 (文科省マテリアル先端リサーチインフラ[ARIM]ご利用の場合、3,300円/時間) (改定前と同じ)

分類	番号	ARIM 機器ID	装置名称	メーカー/型番	ARIM データ提供あり 使用料 (円/時間)	ARIM データ提供なし 使用料 (円/時間)	非公開利用 使用料 (円/時間)	改定前 使用料	対応バリエーション	備考/簡単な仕様、装置の特徴等
洗浄・乾燥	A-01	TU-001	エッチングチャンバー	アズワン PSH1200	2,020	2,526	3,032	2,346	最大8インチ	酸洗浄、ウェットエッチング (Si, SiO ₂ , 金属など)
	A-02	TU-002	有機ドラフトチャンバー		1,988	2,486	2,984	2,308	最大6インチ	有機洗浄、レジスト剥離
	A-03	TU-003	リン酸槽		2,376	2,970	3,564	2,748	最大8インチ	SiNWエッチング
	A-04	TU-004	スピン乾燥機	東邦化成 ZAA-4	3,116	3,894	4,672	3,490	最大6インチ	平置き式でウェハやフォトマスクの乾燥
	A-05	TU-005	4"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101	3,460	4,326	5,192	3,662	4インチ	カセット式で1度に25枚まで処理可能
	A-06	TU-006	6"スピン乾燥機	SEMITOOL PSC101	3,460	4,326	5,192	3,662	6インチ	カセット式で1度に25枚まで処理可能
	A-07	TU-007	シッター用オープン	ヤマト科学 DN63H	2,562	3,202	3,842	2,718	最大6インチ	N ₂ 雰囲気中での熱処理、Alシランリングなど
	A-08	TU-008	真空オープン	ヤマト科学 DP-31	1,700	2,124	2,548	1,978	最大8インチ	真空中での熱処理
	A-09	TU-009	ブラシスクラバ	全協化成	7,444	9,306	11,168	8,110	最大6インチ	研磨後のウェハ洗浄
リソグラフィ	B-01	TU-051	ミカサ スピンコート	ミカサ 1H-DXII	2,856	3,570	4,284	3,206	最大4インチ	レジスト等のスピンコーティング
	B-02	TU-052	アクテス スピンコート#1	アクテス ASC-4000	3,020	3,776	4,532	3,372	最大6インチ	レジスト等のスピンコーティング
	B-03	TU-053	アクテス スピンコート#2	アクテス ASC-4000w	3,064	3,830	4,596	3,420	最大8インチ	レジスト等のスピンコーティング
	B-04	TU-054	ホットプレート	Shamal HHP-230SQ	1,708	2,136	2,564	1,952	最大8インチ	設定温度: 40~400℃、温度分布精度: ±1℃
	B-05	TU-055	クリーンオープン	ヤマト科学 DE62	3,834	4,792	5,750	4,024	最大8インチ	ウェハのベーク
	B-06	TU-056	両面アライナ #1	Suss MA6/BA6	3,868	4,834	5,800	4,490	最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント、接合時のアライメント
	B-07	TU-056	両面アライナ #2	Suss MA6/BA6	3,868	4,834	5,800	4,490	最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント、接合時のアライメント
	B-08	TU-057	レーザー描画装置	Heidelberg Instruments DWL2000CE	9,068	11,334	13,600	9,882	最大9インチ角	波長: 405nm、最小描画線幅: 0.7μm、マスク作製 (Cr, Eマルジョン)、直接描画、グレイスケール露光
	B-09	TU-058	マスクレスアライナ	Heidelberg Instruments MLA150	6,460	8,074	9,688	7,026	最大8インチ角	波長: 405nm 375nm、最小描画線幅: 1μm、マスク作製 (Cr, Eマルジョン)、超高速直接描画、裏面アライメント
	B-10	TU-059	スプレー現象装置	アクテス ADE-3000S	2,732	3,414	4,096	3,120	最大6インチ	現象液とリンス (水) をノズルから噴霧
	B-11	TU-060	現像ドラフト		1,988	2,486	2,984	2,308	最大6インチ	レジスト現像用のドラフトチャンバー
	B-12	TU-061	スピン乾燥機	東邦化成 ZAA-4	2,816	3,520	4,224	3,054	最大6インチ	平置き式でウェハやフォトマスクの乾燥
	B-13	TU-062	コートデベロッパ	Suss ACS200Gen3	12,246	15,308	18,370	12,928	最大8インチ	2~8インチ、HMDS処理、コート 3ライン、現像 2ライン、エッチリンス、バックリンス、ホットプレート 4セット、クルプレート 1セット
	B-14	TU-063	i線ステツバ	キヤノン FPA-3030i5+	21,182	26,478	41,800	22,220	最大8インチ	小片~8インチ、最小線幅 0.35μm以下、重ね合せ精度 40nm、両面アライメント対応、透明基板対応、反り基板対応、Nikonレチクル対応
	B-15	TU-064	エリオニクス 130kV EB描画装置	エリオニクス ELS-G125S	10,258	12,822	15,386	11,804	最大6インチ	最大加速電圧: 130keV、最小描画パターン: 10nm以下
	B-16	TU-065	エリオニクス 50kV EB描画装置	エリオニクス ELS-7500X	4,382	5,478	6,574	4,696	最大4インチ	最大加速電圧: 50keV
	B-17	TU-066	ポリミドキュア炉	ヤマト科学 DN43H	2,478	3,098	3,718	2,944	最大8インチ	N ₂ 雰囲気中でのポリミドのキュア
	B-18	TU-067	UV キュア装置	ウシオ電機 UMA-802	4,780	5,976	7,172	5,152	4インチ	レジストのキュア、カセットtoカセット
	B-19	TU-068	球面露光装置	東栄科学産業	4,662	5,828	6,994	5,388	球面体	球面体 (直径1.0, 3.3mm) へのマスクレス露光、最小パターン: 1.5μm/ハーピッチ、アライメント精度: ±5μm
	B-20	TU-069	両面アライナ #3	SUSS MA8/BA8 Gen3	5,314	6,642	7,970		最大6インチ	コンタクト露光、片面・両面アライメント
酸化拡散・イオン注入・熱処理	C-01	TU-101	酸化炉 (半導体用)	東京エレクトロン XL-7	12,590	15,738	18,886	13,310	最大6インチ	酸化膜形成、半導体ウェハ用
	C-02	TU-101	酸化炉 (MEMS用)	東京エレクトロン XL-7	10,558	13,198	15,838	11,328	最大6インチ	酸化膜形成、MEMSウェハ用
	C-03	TU-102	酸化炉 (8")	光洋サーモシステム	9,676	12,096	14,516	10,178	最大8インチ	酸化膜形成、8インチ用
	C-04	TU-103	拡散炉 (P拡散炉)	東京エレクトロン XL-7	13,652	17,064	20,476	14,406	最大6インチ	P拡散 (アジテ用)
	C-05	TU-103	拡散炉 (P押し込み炉)	東京エレクトロン XL-7	12,300	15,374	18,448	13,036	最大6インチ	P拡散 (ドライブイン用)
	C-06	TU-103	拡散炉 (B拡散炉)	東京エレクトロン XL-7	12,854	16,068	19,282	13,600	最大6インチ	B拡散 (アジテ用)
	C-07	TU-103	拡散炉 (B押し込み炉)	東京エレクトロン XL-7	11,548	14,434	17,320	12,234	最大6インチ	B拡散 (ドライブイン用)
	C-08	TU-104	メタル拡散炉	光洋リンドバグ Model270	8,788	10,986	13,184	9,284	最大4インチ	最高温度: 1000℃、メタルや圧電基板等の多用途拡散
	C-09	TU-105	中電流イオン注入装置	日新イオン機器 NH-20SR	21,996	27,494	32,992	23,236	最大4インチ	最大加速電圧: 180keV、最大電流: 0.6mA、注入可能元素: P, B、カセットtoカセット
	C-10	TU-106	アニール炉	東京エレクトロン XL-7	11,238	14,048	16,858	11,830	最大6インチ	イオン注入後のアニール
	C-11	TU-107	ランプアニール装置	AG Associates AG4100	9,468	11,834	14,200	10,238	最大6インチ	最高温度: 1100℃、昇温速度: 100℃/sec、カセットtoカセット
	C-12	TU-108	水素アニール炉	金森義明教授オリジナル	13,884	17,354	20,824	17,042	最大6インチ	最高温度: 1100℃、クレーンな環境下での赤外線ランプ加熱、Si専用
	C-13	TU-109	真空アニール炉	真空理工 RHL-Pss98/98#	6,782	8,478	10,174	6,808	最大4インチ	真空中での熱処理 (酸素、窒素雰囲気中の処理対応未確認)
成膜	D-01	TU-151	LPCVD (SiN)	システムサービス	12,164	15,204	18,244	14,026	最大6インチ	SiN
	D-02	TU-151	LPCVD (Poly-Si)	システムサービス	16,292	20,364	24,436	18,586	最大6インチ	Poly-Si
	D-03	TU-151	LPCVD (SiO ₂ , SiON)	システムサービス	14,280	17,850	21,420	15,942	最大6インチ	SiO ₂ (NSG)、SiON
	D-04	TU-152	熱CVD	国際電気	27,448	34,310	41,172	28,692	最大6インチ	Epipoly-Si(non-doped, doped)、Poly-Si(non-doped, doped)、最高温度: 1100℃
	D-05	TU-153	住友精密PECVD	住友精密 MPX-CVD	18,580	23,224	27,868	19,940	最大8インチ	SiN, SiO ₂ 、最高温度: 350℃、低応力SiN成膜
	D-06	TU-154	住友精密TEOS PECVD	住友精密 MPX-CVD	20,702	25,878	31,054	22,012	最大8インチ	TEOS SiO ₂ , SiN、最高温度: 350℃、低応力成膜
	D-07	TU-155	SPPテクノロジー TEOS PECVD	SPPテクノロジー APX-Cetus	18,542	23,178	27,814	20,362	最大8インチ	TEOS SiO ₂ , SiN、基板サイズ 小片~8インチ、最高温度 350℃、低応力SiN成膜
	D-08	TU-156	JPEL PECVD	日本生産技術研究所 VDS-5600	13,910	17,388	20,866	16,934	最大6インチ	SiN, SiO ₂ 、パッチ式: 4インチ×13枚、6インチ×8枚
	D-09	TU-157	W-CVD	Applied Materials P-5000	11,580	14,476	17,372	12,742	4インチ	タングステン成膜
	D-10	TU-158	芝浦スパッタ装置 (加熱型)	芝浦メカトロニクス CFS-4ESI	4,740	5,924	7,108	5,242	最大8インチ	基板ステージφ200mm、3インチターゲット×3、基板加熱形 (最高300℃)
	D-11	TU-159	芝浦スパッタ装置 (冷却型)	芝浦メカトロニクス CFS-4ESI	4,758	5,948	7,138	5,264	最大8インチ	基板ステージφ200mm、3インチターゲット×3、基板水冷形、リフトオフプロセス可
	D-12	TU-160	自動搬送 芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス I-Miller CFS-4EP-LL	7,172	8,966	10,760	7,924	最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板加熱形 (最高300℃)、ロードロック付、自動搬送付
	D-13	TU-161	自動搬送 芝浦スパッタ装置 (冷却型)	芝浦メカトロニクス I-Miller CFS-4EP-LL	8,782	10,978	13,174	新規	最大8インチ	基板ステージφ220mm、3インチターゲット×4、基板冷却型、リフトオフプロセス可、ロードロック付、自動搬送付
	D-14	TU-162	ECRリングスロースパッタ	エリオニクス EIS-200ERP-NPD-TK	7,220	9,024	10,828	7,602	最大6インチ	小片~6インチ、ターゲット数 2、ターゲット-ステージ間距離 150mm、コリメータ付、エッチング可
	D-15	TU-163	アネルバマルチスパッタ	アネルバ SPC-350	6,260	7,824	9,388	7,438	4インチ	1/インチ最大6枚搭載可能 (回転機構付)、6インチターゲット×3 (DC×2, RF×1: 同時放電可能)、基板加熱形 (最高650℃)、強磁性体対応、ロードロック付、クワイアポンプ
	D-16	TU-164	酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	ユーテック 21-0604	12,528	15,660	18,792	13,746	最大8インチ	金属用(DC)スパッタチャンバ、酸化物用(RF)スパッタチャンバ、酸素加圧アニールチャンバの3つのチャンバで構成。最高基板温度は700℃。主にPZT下地成膜、PZT成膜用。
	D-17	TU-165	アネルバスパッタ装置	アネルバ SPF-730	8,780	10,974	13,168	10,438	最大6インチ	1/インチ9枚 (4インチ)、8インチターゲット×3
	D-18	TU-166	球面成膜用スパッタ装置	和泉テック	5,466	6,832	8,198	6,022	球面体	球面体 (直径1.0, 3.3mm) へのスパッタリング、膜種: Au, Cr, Al, Pd, SiO ₂ 他、O ₂ プラズマクリーニング可
	D-19	TU-167	電子ビーム蒸着装置	アネルバ EVC-1501	7,592	9,490	11,388	8,584	最大6インチ	主に金属薄膜の蒸着
	D-20	TU-168	めっき装置	山本鍍金試験器	2,752	3,440	4,128	3,146	最大6インチ	Cu, Ni, Sn, Au
	D-21	TU-169	多元材料原子層堆積(ALD)装置	テクノファイン ALK-600	10,052	12,564	15,076	10,818	最大6インチ	アルミナ等のALDが可能。6インチウェハまでの導入が可能。アルミナ以外は、要原料。
	D-22	TU-170	ゾルゲル自動成膜装置	テクノファイン PZ-604	8,934	11,168	13,402	10,016	最大4インチ	PZT成膜
	D-23	TU-171	MOCVD	ワコム研究所 Doctor T	17,780	22,224	26,668	20,266	最大8インチ	PZT成膜等
	D-24	TU-172	シンクロン スパッタ装置	シンクロン RAS-1100B II	58,294	72,868	87,442	57,862	4インチ	36枚同時成膜が可能。Si, Ta, Al, W, SiO ₂ , Ta ₂ O ₅ 成膜可能。

エッチング	E-01	TU-201	DeepRIE装置#1	住友精密 MUC-21	9,446	11,808	14,170	9,866	最大6インチ	Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-02	TU-202	DeepRIE装置#2	住友精密 MUC-21	9,446	11,808	14,170	9,856	最大6インチ	Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-03	TU-203	DeepRIE装置#3	STS	9,580	11,974	14,368	10,084	最大6インチ	Siの深堀エッチング、メカニカルチャック
	E-04	TU-204	DeepRIE装置#4	住友精密 MUC-21	16,064	20,080	24,096	16,774	最大8インチ	Siの深堀エッチング、静電チャック
	E-05	TU-205	アルバックICP-RIE#1	アルバック NE-550	17,598	21,998	26,398	19,480	最大6インチ	SiO ₂ 、メタルなどの多目的ドライエッチング、静電チャック、ガス：CF ₄ 、CHF ₃ 、SF ₆ 、Ar、O ₂ 、N ₂ 、Cl ₂ 、BCl ₃
	E-06	TU-206	アルバックICP-RIE#2	アルバック CE-300I	16,910	21,138	25,366	18,270	最大6インチ	SiO ₂ 、メタルなどの多目的ドライエッチング、静電チャック、ガス：CF ₄ 、CHF ₃ 、SF ₆ 、Ar、O ₂ 、N ₂ 、Cl ₂ 、BCl ₃
	E-07	TU-207	アルバック多用途RIE装置	アルバック RIH-1515Z	11,222	14,028	16,834	12,532	最大6インチ	金属膜や圧電膜も対象とした多目的ドライエッチング、ガス：Cl ₂ 、BCl ₃ 、SF ₆ 、CF ₄ 、CHF ₃ 、Ar、N ₂ 、O ₂
	E-08	TU-208	アネルバRIE装置	アネルバ DEA-506	8,724	10,906	13,088	9,234	最大8インチ	SiN、SiO ₂ のドライエッチング、ガス：CF ₄ 、CHF ₃
	E-09	TU-209	アネルバSi RIE装置	アネルバ L-507DL	7,348	9,186	11,024	7,992	最大6インチ	Siのドライエッチング、ガス：SF ₆
	E-10	TU-210	AI-RIE装置	芝浦メカトロニクス HIRRIE-100	12,880	16,100	19,320	13,888	最大6インチ	AlやSiのドライエッチング、カセットtoカセット、ガス：Cl ₂ 、BCl ₃
	E-11	TU-211	プラズマクリーナー	ヤマト科学 PDC210	3,888	4,860	5,832	4,440	最大6インチ	O ₂ またはArによるウエハ表面のプラズマクリーニング、レジストアッシング
	E-12	TU-212	アルバック アッシング装置	アルバック UNA-2000	4,930	6,162	7,394	5,356	最大6インチ	2.45GHz z、カセットtoカセット
	E-13	TU-213	プランソア アッシング装置	プランソア IPC4000	4,486	5,608	6,730	4,942	最大6インチ	13.56MHz z
	E-14	TU-214	ケミカルドライエッチャ(CDE)	芝浦メカトロニクス CDE7	7,212	9,016	10,820	7,702	最大4インチ	ラジカルによる低ダメージのSi、SiN等方向性ドライエッチング、DRIE後のスクラップ除去、ガス：CF ₄ 、O ₂ 、N ₂
	E-15	TU-215	イオンミリング装置	エヌ・エス/伯東 201BE-C	11,328	14,160	16,992	12,742	最大6インチ	Arイオン、4インチ×6枚、6インチ×3枚
	E-16	TU-216	Vapor HFエッチング装置	住友精密 Primaxx uEtch	9,402	11,752	14,102	10,296	最大8インチ	気相フッ酸による主にSiO ₂ 犠牲層エッチング
	E-17	TU-217	KOHエッチング槽		3,312	4,140	4,968	3,736	最大6インチ	Si結晶異方性エッチング
	E-18	TU-218	TMAHエッチング槽		3,844	4,804	5,764	4,364	最大6インチ	Si結晶異方性エッチング
接合・研磨・パッキング	F-01	TU-251	Suss ウェハ接合装置	Suss SB6e	6,460	8,074	9,688	6,946	最大6インチ	陽極接合、金属接合、ポリマー接合
	F-02	TU-252	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG Smart View Aligner	5,796	7,244	8,692	6,242	最大8インチ	IR透過アライメント可能
	F-03	TU-253	EVG ウェハ接合装置	EVG 520	6,278	7,848	9,418	6,962	最大8インチ	熱圧着接合用
	F-04	TU-254	EVG プラズマ活性化装置	EVG 810	8,364	10,454	12,544	9,502	最大6インチ	直接接合前のプラズマ活性化処理 標準ガス：N ₂
	F-05	TU-255	ディスク ダイサ	ディスク DAD-522	3,308	4,136	4,964	3,760	最大6インチ	切削水：水道水
	F-06	TU-256	東京精密 ダイサ	東京精密	10,366	12,958	15,550	11,830	最大6インチ	切削水：純水
	F-07	TU-257	ワイヤボンダ	West Bond	1,844	2,304	2,764	2,190	チップ	Al、Au
	F-08	TU-258	レーザーマーカ	GSI ルミノス WM-II	3,284	4,106	4,928	3,468	4インチ	ウェハのマーキング
	F-09	TU-259	サンドブラスト	新東	3,832	4,790	5,748	4,224	最大6インチ	ガラスの穴あけ加工
	F-10	TU-260	4インチウェハ研磨装置	BNテックロジ Bni52	2,126	2,658	3,190	2,440	最大4インチ	Si、SiO ₂ 、金属などの研磨、CMP
	F-11	TU-261	6インチウェハ研磨装置	BNテックロジ Bni62	2,432	3,040	3,648	2,750	最大6インチ	Si、SiO ₂ 、金属などの研磨、CMP
	F-12	TU-262	サーフェイスプレーナ	ディスク DAS8920	15,880	19,850	23,820	17,790	4.8インチ	Au、Cu/npの平坦化
	F-13	TU-263	UVインプリント装置	東芝機械 ST-50	6,498	8,122	9,746	8,054	最大4インチ	UV光を用いたインプリント装置、ステップ&ピート可能
	F-14	TU-264	熱インプリント装置	オリジ電気 Reprina-T50A	6,510	8,138	9,766	7,470	最大2インチ	最大650℃、最大30kN
	F-15	TU-265	Eキシ洗浄装置	デアネヒステ EXC-1201-DN	3,308	4,136	4,964	3,750	最大4インチ	ウェハや石英モールド上の有機物の除去
	F-16	TU-266	セミオートワイヤボンダ	TPT HB16	1,772	2,214	2,656	2,048		ボールボンダ、ウェッジボンダの両方が可能、セミオート対応
	F-17	TU-267	サブフェムト・インクジェット	SUITEC/ロジ PR150-THU	4,476	5,596	6,716	5,314		最小線幅：約5μm
	F-18	TU-268	光造形3Dプリンタ	シーフォース 0283 plus	2,780	3,476	4,172	3,244		最小積層ピッチ：0.01mm、最大造形サイズ：90mm x 90mm x 90mm
	F-19	TU-269	マイクロコンピュータ	マイクロサポート	1,812	2,264	2,716	2,096		マイクロスコピー一体型マイクロコンピュータシステム
	F-20	TU-270	ウォーターレーザ	浜谷工業 LAMICS AQL-1900	6,288	7,860	9,432	6,628	最大12インチ	シリコンウエハや金属薄板の加工（ガラスなどの透明材料はNG）、最小加工線幅：約70μm
測定	G-01	TU-301	ウェハ3D検査装置	トプコン WM-3	2,692	3,366	4,040	3,198	最大6インチ	ウェハ上のパーティクル測定（数、大きさ）
	G-02	TU-302	膜厚計	ナノメトリクス NanoSpec3000	2,080	2,600	3,120	2,402	最大6インチ	光学式の膜厚測定
	G-03	TU-303	卓上型エリブソ	フォトニックラティス SE-101	1,456	1,820	2,184	1,750	最大6インチ	高速サンプリング可能なエリブソ
	G-04	TU-304	エリブソ	アルバック	1,660	2,074	2,488	1,976	最大6インチ	薄膜の厚さ、屈折率測定
	G-05	TU-305	Dektak 段差計	Dektak 8	2,330	2,912	3,494	2,666	最大6インチ	触針式の表面形状測定
	G-06	TU-306	Tencor 段差計	Tencor AlphaStep 500	2,330	2,912	3,494	2,666	最大6インチ	触針式の表面形状測定
	G-07	TU-307	金属顕微鏡	ニコン L150	1,836	2,296	2,756	2,148	最大6インチ	パターン観察
	G-08	TU-308	デジタル顕微鏡	キーエンス/クノータクノクラフト	2,242	2,802	3,362	2,582	最大8インチ	パターン観察、デジタル画像保存、電動ステージ（PC制御可）、20～200倍、500～5000倍
	G-09	TU-309	赤外線顕微鏡	オリンパス/浜松ホトニクス	1,912	2,390	2,868	2,244	最大6インチ	断面アライメントの確認、ウェハ接合面のポイド評価等
	G-10	TU-310	レーザー/白色共焦点顕微鏡	レーザーテック OPTELICS HYBRID LS-SD	5,596	6,996	8,396	6,862	最大6インチ	3次元表面形状測定、DeepRIEのエッチ深さ測定、レーザー光/白色の切替可能、共焦点/非共焦点の切替可能
	G-11	TU-311	深さ測定装置	エプソン光学 Hisomet	1,644	2,054	2,464	1,966	最大6インチ	光学式非接触深さ測定装置
	G-12	TU-312	超音波顕微鏡	インサイト IS-350	2,474	3,092	3,710	2,854	最大12インチ	デバイス内部の非破壊検査、ウェハ接合面の欠陥、ポイド評価等
	G-13	TU-313	マイクロX線CT	コムキャンテクノ ScanXmate D160TS110	4,104	5,130	6,156	4,348	最大6インチ	X線を用いた非破壊内部観察
	G-14	TU-314	熱電子SEM	日立 S3700N	4,150	5,188	6,226	4,986	最大12インチ	EDX付、低真空モード付、光学画像ナビゲーション付
	G-15	TU-315	断面SEM	日立 S5000	5,444	6,804	8,164	6,208	小片	小片専用、インレンズ式の高分解能FESEM
	G-16	TU-316	JEOL FE-SEM	日本電子 JSM-6335F	6,044	7,554	9,064	6,356	最大4インチ	電界放出型SEM、EDX付
	G-17	TU-317	測長SEM	日立ハイテック CS4800	16,870	21,088	25,306	新規	最大8インチ	微細構造の高精度自動測長 6.8インチは自動搬送、4インチ以下は手動搬送 計測再現性：1nm(3σ)
	G-18	TU-318	クイックコータ	サンヨー電子 SC-701MkII	2,116	2,644	3,172	2,460	最大2インチ	SEM観察試料のPCコーティング
	G-19	TU-319	パーク・システムズAFM	パーク・システムズ NX20	3,290	4,112	4,934	3,724	最大8インチ	小片から8インチまで対応する原子間力顕微鏡
	G-20	TU-320	4探針測定装置		1,744	2,180	2,616	2,078	最大6インチ	ウェハ抵抗率などの測定
	G-21	TU-321	拡がり抵抗測定装置	Solid State Measurements SSM150	3,294	4,118	4,942	3,840	小片	不純物濃度プロファイルの測定、ウェハを小片にして端面を斜め研磨した後に測定
	G-22	TU-322	FIB	SII SMI9200	9,852	12,314	14,776	11,190	小片	集束イオンビームによる微小部分のエッチング、SEM観察用断面作製
	G-23	TU-323	XRD	ブルカー・エイックスリス D8 DISCOVER	10,328	12,910	15,492	9,854	最大6インチ	X線回折測定、1000℃までの高温環境での測定可能
	G-24	TU-324	直線集束電子線超音波材料解析システム#1		4,508	5,636	6,764	4,860	最大6インチ	固体試料の縦弾性表面波(LSAW)速度測定
	G-25	TU-325	直線集束電子線超音波材料解析システム#2		4,508	5,636	6,764	4,860	最大8インチ	固体試料のバルク波（縦波、横波）音速測定
	G-26	TU-326	Zygo Nexview	Zygo Nexview	3,892	4,864	5,836	4,496	最大6インチ	表面形状の精密測定
	G-27	TU-327	半導体パラメータアナライザ	Keysight B1500A SMU B1511B x4 GNDU	1,736	2,170	2,604	1,998		半導体デバイスの特性評価
	G-28	TU-328	2光子励起顕微鏡	ライカ TCS SP8 MP STED	3,356	4,196	5,036	3,630		マルチフォトンレーザー顕微鏡システム、超解像オプティクス付、細胞の高精細蛍光イメージング